

Kinetic Effects in RF Discharges

Philipp Hacker

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Physik

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

4. Dezember 2017

Betreuer: Prof. Dr. R. Schneider Gutachter: Prof. Dr. J. Meichsner

Motivation

1. Motivation

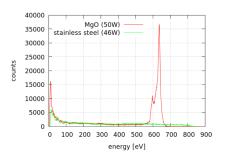
Motivation

- 2. Experiment
- 3. Particle-in-Cell Methode
- 4. 1D Simulation
- 5. Simulationen in 2D
- 6. Ausblick

Kapazitive gekopplte RF-Plasmen



- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffer schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen

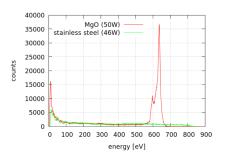


(Negative Ionen Energieverteilung in Sauerstoffentladungen) [2]

Kapazitive gekopplte RF-Plasmen



- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Obertlachenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen

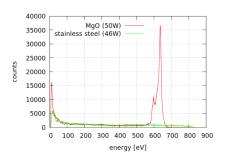


(Negative Ionen Energieverteilung in Sauerstoffentladungen) [2]

Kapazitive gekopplte RF-Plasmen



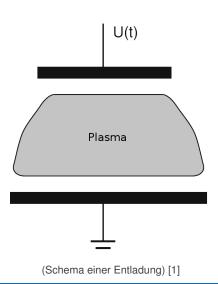
- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen



(Negative Ionen Energieverteilung in Sauerstoffentladungen) [2]

Randschichteffekte





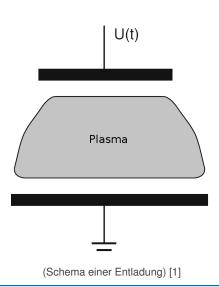
- negative Aufladung der Wände durch schnellere Elektronen →Self-Bias
- Ionen werden auf Bohm-Geschwindigkeit beschleunigt /kpTa

$$v_{\mathsf{i},\mathsf{B}} = \sqrt{\frac{k_{\mathsf{B}}T_{\mathsf{e}}}{m_{\mathsf{i}}}}$$

 Asymmetrie der getriebenen/geerden Elektroden

Randschichteffekte





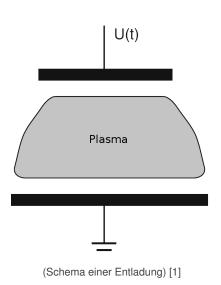
- negative Aufladung der Wände durch schnellere Elektronen →Self-Bias
- Ionen werden auf Bohm-Geschwindigkeit beschleunigt

$$v_{\mathsf{i},\mathsf{B}} = \sqrt{\frac{k_{\mathsf{B}}T_{\mathsf{e}}}{m_{\mathsf{i}}}}$$

 Asymmetrie der getriebenen/geerden Elektroden

Randschichteffekte





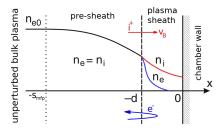
- negative Aufladung der Wände durch schnellere Elektronen
 →Self-Bias
- Ionen werden auf Bohm-Geschwindigkeit beschleunigt

$$v_{\mathsf{i},\mathsf{B}} = \sqrt{\frac{k_\mathsf{B} T_\mathsf{e}}{m_\mathsf{i}}}$$

 Asymmetrie der getriebenen/geerden Elektroden

Randschichteffekte



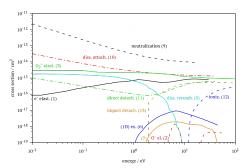


(Dichte und Potential vor einer Wand) [1]

 Kapazitive Kopplung führt zur Verschiebung des Plasma-Potentials

Oberflächen- und Stoßprozesse





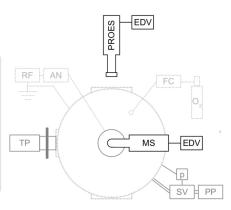
Nr.	Reaction	Type
	Electron and ion reactions	Creation and loss
(8)	$e^- + O_2^+ \rightarrow 2 O$	Dissociative recombination
(9)	$O^- + O_2^+ \rightarrow O_2 + O$	Neutralization
(10)	$e^- + O_2 \rightarrow O + O^-$	Dissociative attachment
(11)	$O^- + O_2 \rightarrow O + O_2 + e$	Direct detachment
(12)	$e^- + O_2 \rightarrow 2e^- + O_2^+$	Impact ionisation
(13)	$e^- + O^- \rightarrow O + 2e^-$	Impact detachment

(ausgewählte Stoßquerschnitte in Sauerstoff)

Das Experiment



- große Asymmetrie zwischen geerdeter Kammer und CCRF-Elektrode
- niedrige Gasflüsse und -drücke (<5 sccm. 15 Pa)
- Flektrodenabstand ~5 cm

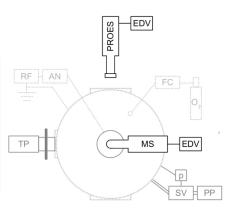


(Draufsicht des Experimentes) [2]

Das Experiment



- große Asymmetrie zwischen geerdeter Kammer und CCRF-Elektrode
- niedrige Gasflüsse und -drücke (<5 sccm, 15 Pa)
- Flektrodenabstand ~5 cm



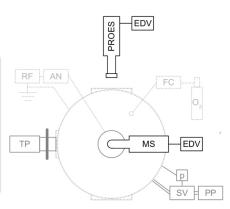
(Draufsicht des Experimentes) [2]

Das Experiment

Motivation

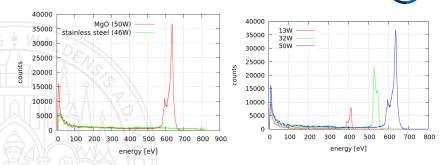


- große Asymmetrie zwischen geerdeter Kammer und CCRF-Elektrode
- niedrige Gasflüsse und -drücke (<5 sccm, 15 Pa)
- Elektrodenabstand ~5 cm



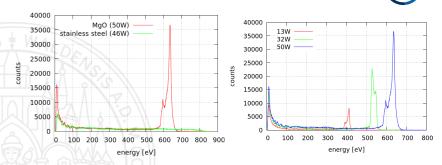
(Draufsicht des Experimentes) [2]





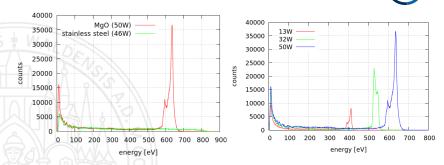
Struktur in EVF der negativen Ionen in Sauerstoff, Scheuer et. al [2] Hochenergetische Spitze in Abhängigkeit der Leistung und Material





Struktur in EVF der negativen Ionen in Sauerstoff, Scheuer et. al [2] Hochenergetische Spitze in Abhängigkeit der Leistung und Material

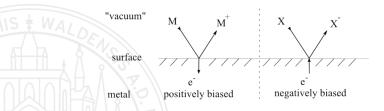




Struktur in EVF der negativen Ionen in Sauerstoff, Scheuer et. al [2] Hochenergetische Spitze in Abhängigkeit der Leistung und Material

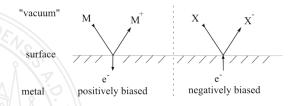
Anionen von der Elektrode?





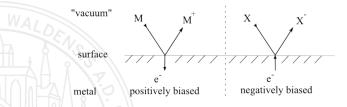
Saha-Langmuir Gleichung:

Ionisation hängt von Austrittsarbeit, Ionisationsenergie, Oberflächentemperatur, Spannung und quantenmechanischen Koeffizienten des Materials ab



Saha-Langmuir Gleichung: Ionisation hängt von Austrittsarbeit, Ionisationsenergie, Oberflächentemperatur, Spannung und quantenmechanischen Koeffizienten des Materials ab



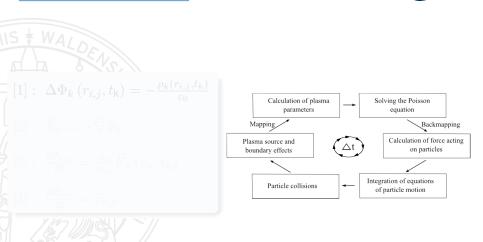


Saha-Langmuir Gleichung:

lonisation hängt von Austrittsarbeit, lonisationsenergie,

Oberflächentemperatur, Spannung und quantenmechanischen





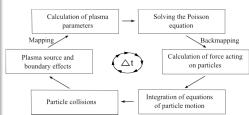




$$[2]: \vec{E}_k = -\vec{\nabla}\Phi_k$$

$$[3]: \frac{\operatorname{d}\vec{v}_{k,n}}{\operatorname{d}t} = \frac{q_n}{m_n} \vec{E}_k \left(r_n, t_k \right)$$

$$[4]: \frac{d\vec{x}_{k,n}}{dt} = \vec{v}_{k,r}$$



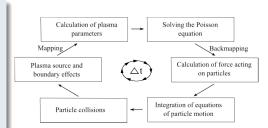


[1]:
$$\Delta \Phi_k (r_{i,j}, t_k) = -\frac{\rho_k(r_{i,j}, t_k)}{\varepsilon_0}$$

$$[2]: \vec{E}_k = -\vec{\nabla}\Phi_k$$

$$[3]: \frac{\operatorname{d}\vec{v}_{k,n}}{\operatorname{d}t} = \frac{q_n}{m_n} \vec{E}_k \left(r_n, t_k \right)$$

$$[4]: \frac{d\vec{x}_{k,n}}{dt} = \vec{v}_{k,n}$$



Literatur

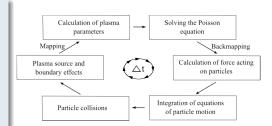


[1]:
$$\Delta \Phi_k (r_{i,j}, t_k) = -\frac{\rho_k(r_{i,j}, t_k)}{\varepsilon_0}$$

$$[2]: \vec{E}_k = -\vec{\nabla}\Phi_k$$

$$[3]:\ \frac{\mathrm{d}\vec{v}_{k,n}}{\mathrm{d}t} = \frac{q_n}{m_n}\vec{E}_k\left(r_n,t_k\right)$$

$$[4]: \frac{d\vec{x}_{k,n}}{dt} = \vec{v}_{k,n}$$



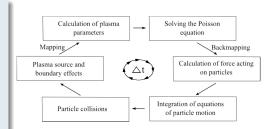


[1]:
$$\Delta \Phi_k (r_{i,j}, t_k) = -\frac{\rho_k(r_{i,j}, t_k)}{\varepsilon_0}$$

$$[2]: \vec{E}_k = -\vec{\nabla}\Phi_k$$

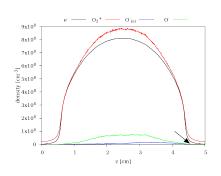
$$[3]: \ \frac{\mathrm{d}\vec{v}_{k,n}}{\mathrm{d}t} = \frac{q_n}{m_n} \vec{E}_k \left(r_n, t_k \right)$$

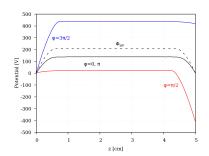
$$[4]: \frac{d\vec{x}_{k,n}}{dt} = \vec{v}_{k,n}$$



1D Simulation







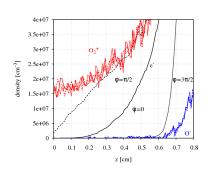
(Entladung bei 5 Pa und 400 V)

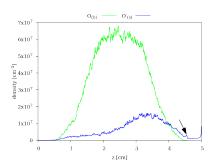
Dichte und phasenaufgelöstes Potential in 1D mit Injektion negativer lonen von der Kathode

$$\Rightarrow \eta = I(O^{-})/I(O_{2}) = 0.03$$

1D Simulation





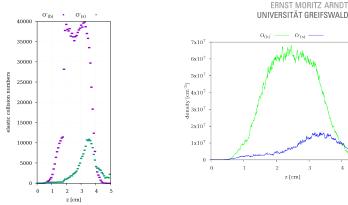


(Entladung bei 5 Pa und 400 V)

Dichte und phasenaufgelöstes Potential in 1D mit Injektion negativer lonen von der Kathode

$$\Rightarrow \eta = I(O^{-})/I(O_{2}) = 0.03$$

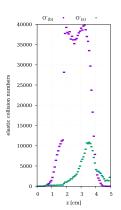


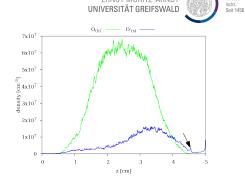


Wissen lockt.

O'(s)

Seit 1456





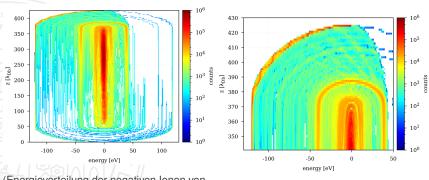
FRNST MORITZ ARNOT

 \Rightarrow Schicht nicht vollständig stoßlos Dynamik der schnellen negativen Ionen von der gegenueberliegenden Elektrode stark durch elastische Stöße mit O_2 beeinflusst

Wissen

Dynamik negativer lonen





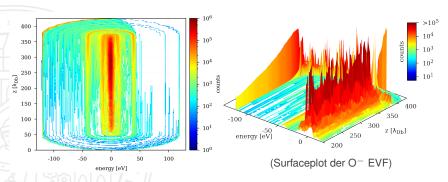
(Energieverteilung der negativen Ionen von der Oberfläche)

(Anodenbereich der EVF von O⁻)

hochenergetische Struktur bei $\sim \! 100\, {\rm eV}$ vor Anode, abnehmend zur Kathode mit mittlerer freien Weglänge der O $^-$

Dynamik negativer lonen



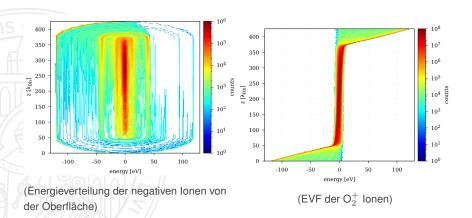


(Energieverteilung der negativen lonen von der Oberfläche)

hochenergetische Struktur bei $\sim \! 100\, {\rm eV}$ vor Anode, abnehmend zur Kathode mit mittlerer freien Weglänge der O $^-$

Dynamik negativer Ionen

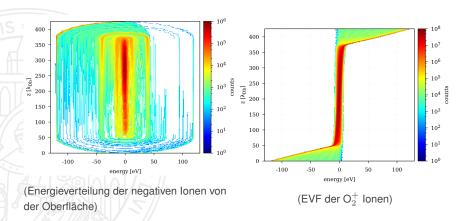




langsame Ionen im Bulk der Entladung \rightarrow schnelle O $^-$ abgebremst und kehren in Randschicht um

Dynamik negativer lonen

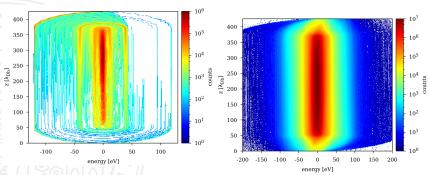




Struktur über großen Energiebereich vor den Elektroden?

Dynamik negativer Ionen





(Energieverteilung der negativen Ionen von der Oberfläche)

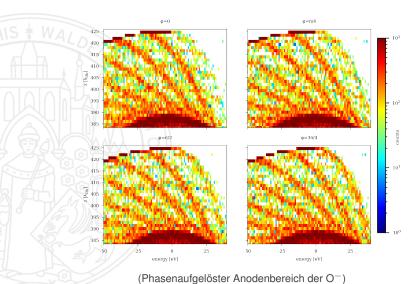
(EVF der Elektronen)

Struktur über großen Energiebereich vor den Elektroden? bei Elektronen keine sichtbar!

Dynamik negativer Ionen

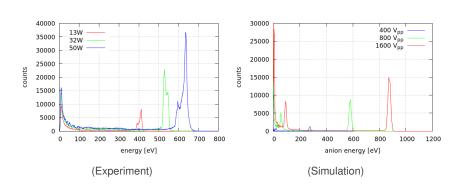
Motivation





Experiment-Vergleich

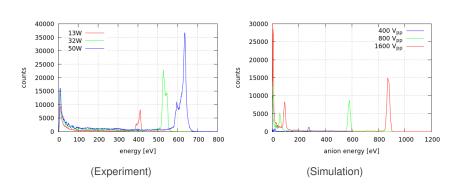




 bisher: Vermutung für hochenergetische Struktur in O⁻ EVF im Vergleich zu Experiment bestätigt

Experiment-Vergleich

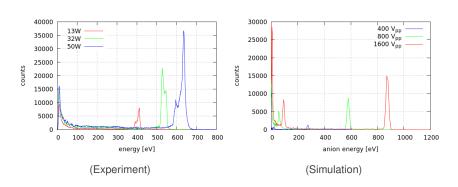




 Spannungsvariation zeigt Abhängigkeit der Energieverteilung der Oberflächenprozesse

Experiment-Vergleich



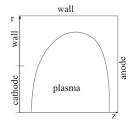


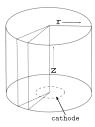
niederergetische Struktur nicht in Experiment zu finden

Simulationen in 2D



- Annahme einer zylinder-symmetrische Entladung um Mitte der Elektrode
- jetzt: verschiedene Kombinationen von Randbedingungen, zBsp.
 Dielektrika
- viel größerer numerischer Aufwand

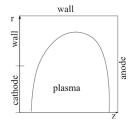


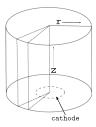


Simulationen in 2D



- Annahme einer zylinder-symmetrische Entladung um Mitte der Elektrode
- jetzt: verschiedene Kombinationen von Randbedingungen, zBsp. Dielektrika
- viel größerer numerischer Aufwand

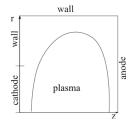


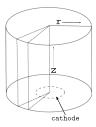


Simulationen in 2D



- Annahme einer zylinder-symmetrische Entladung um Mitte der Elektrode
- jetzt: verschiedene Kombinationen von Randbedingungen, zBsp. Dielektrika
- viel größerer numerischer Aufwand









Negative Ionen EVF





Asymmetrische Ranbedingungen





Einfluss des Self Bias





Ausblick





Referenzen





A. Piel. "Plasma Physics - An Introduction to Laboratory, Space and Fusion Plasmas". In: (2010), pp. 170 ff., 338 ff.



S. Scheuer. "Plasmadiagnostische Untersuchungen zur Charakterisierung von Moden in elektronegativen RF-Plasmen". In: *Master thesis* (2015).